PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-169971

(43) Date of publication of application: 30.06.1997

(51)Int.CI.

CO9K 3/14

B01J 3/06

B24D 3/00

CO1B 21/064

(21)Application number: 07-348603

(71)Applicant: SHOWA DENKO KK

(22)Date of filing:

18.12.1995 (72)Invent

(72)Inventor: SUGANO KATSUO

KASAHARA MAKOTO

OKUBO TAKUYA

MAKI MASAKAZU

(54) CUBIC BORON NITRIDE ABRASIVE GRAIN AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the subject abrasive grain useful as a grinding abrasive grain, a whetstone, coated abrasive, etc., having a specific relatively low bulk specific gravity prescribed as a particle size distribution and a prescribed relatively high toughness value, continuing

a₂ ≦ かさ比重 ≦ a₁

excellent cutting quality.

SOLUTION: This abrasive grain has a particle size distribution based on a regulation of JIS-B4130, belonging to #325/400 to #60/80 and satisfies relative equations, equation 1 (a1=2.581!×10-9 χ 3-2.894×10-7 χ 2-9.491×10-4 χ +1.892; a2=4.316×10-9 χ 3-1.662×10-6 χ 2-5.992×10-4 χ +1.714) and

 $4\chi+1.892$; a2= $4.316\times10-9\chi3-1.662\times10-6\chi2-5.992\times10-4\chi+1.714$) and equation II (3.245×10-6 $\chi3-2.566\times10-3\chi2+7.125\times10-1\chi+9$. 264; b2=3.245×10-6 $\chi3-2.556\times10-3\chi2+7.125\times10-1\chi-6.736$) when the maximum particle size (the minimum value) of each fraction of particle size is χ . A raw material mixture obtained by mixing hexagonal boron nitride with a catalyst for synthesizing cubic boron nitride is further blended with 5-50vol.% of a

b₁ ≦ タフネス ≦ b₁

component inert to a cubic boron nitride synthesis and retained at a high temperature under pressure to give the objective abrasive grain.

П

Ī

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.11.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開發号

特開平9-169971

(43)公開日 平成9年(1997)6月30日

(51) Int.CL ⁶	織別配号	庁内整理番号	ΡI			技術表示箇所
CO9K 3/14	550		C09K	3/14	5501	D
B01J 3/00	1		B01J	3/06	•	r
B 2 4 D 3/00	320		B24D	3/00	320/	A
C01B 21/00	i 4		C01B 2	1/064	1	M
	•		来在音乐	永韶求	菌界項の数4	FD (全 9 四)
(21)出職番号	特顧平7-348603		(71)出廢人			
(on the m	75-3 6 to (1005) 10 II	I I A PI			C株式会社	7.000.0
(22)出版日	平成7年(1995)12月	平成7年(1995)12月18日			を区艺大門1丁F	313番9号
			(72) 宛明者			
					鱼民市大字永贺	1 昭和電工模式会
			()	礼塩尻.		
			(72)発明者		-	
					鱼民市大字永賀	1 昭和電工模式会
				社也兄		
			(72)発明者	大久保	单也	
				長野県	区民 业大学宗贺:	1 昭和電工株式会
				社協兄	工場內	
			(74)代理人	介理 土	内田 幸男	
			1			最終頁に続く

(54)【発明の名称】 立方晶室化ほう素砥粒およびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 肉質が緻密透明であり、形状がシャープで、 研削砥粒として用いたときの切れ味が良く、寿命が長い 立方晶窒化ほう素砥粒を提供する。

【解決手段】 JIS-B4130に基づく粒度分布が325/400~60/80の範圍に属し、且つ、所定の低いかさ比重および所定の高いタフネスを有する立方 晶窒化ほう素砥粒。この砥粒は、六方晶窒化ほう素粒子に触媒および不活性化合物を配合した原料複合物を高温高圧処理して調製される。

(2)

【特許請求の範囲】

【語求項1】 低かさ比重で高タフネス値を有する立方 晶室化ほう素の砥粒であって、JIS-B4130の規 定に基づく粒度の分布が#325/400~#60/8 0の範囲に属し、且つ、同規定に基づく粒度の各区分の 最大粒度(最小数値)をえとするとき、かさ比重および タフネスがそれぞれで記式(1) および(2):

1

$$a_2 \le$$
 かさ此重 $\le a_3$ (1) $b_2 \le 87ネス \le b_3$ (2)

(但し、a、= 2.581×10⁻¹ x '-2.894×1 10 し、さきに特許出願を行った (特闘平2-3593 0⁻¹ x '-9.491×10⁻¹ x +1.892 1)。特闘平2-35931号に記載される方法にa₂=4.316×10⁻¹ x '-1.662×10⁻¹ x ' 製造されるcBN粒子は、高いかさ比重と高いタフ

 $a_2 = 4.316 \times 10^{-9} \chi^3 - 1.662 \times 10^{-9} \chi^4 - 5.992 \times 10^{-4} \chi + 1.714$

 $b_4 = 3. 245 \times 10^{-6} \chi^3 - 2.566 \times 10^{-7} \chi^4 + 7.125 \times 10^{-1} \chi + 9.264$

 $b_z = 3. \ 24.5 \times 10^{-6} \chi^3 - 2. \ 5.6.6 \times 10^{-7} \chi^4 + 7. \ 12.5 \times 10^{-1} \chi - 6. \ 7.3.6$

を満足することを特徴とする立方晶室化ほう素砥粒。

【語求項2】 六方晶窒化ほう素に立方晶窒化はう素合成用触媒を配合した原料混合物を高温高圧下に保持する 20 ことによって立方晶窒化ほう素配粒を合成する方法において、該原料混合物中にさらに5~5 0 容置%の立方晶窒化ほう素合成に不活性な成分を配合した原料混合物を用いることを特徴とする語求項1記載の立方晶窒化ほう素砥粒を製造する方法。

【請求項3】 請求項1記載の立方晶室化ほう素砥粒からなる研削砥石。

【請求項4】 研磨材として請求項1記載の立方晶窒化 ほう素配粒を含んでなる研磨布紙。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、低かさ比重で高タフネス値を有する立方晶室化はう素の砥粒、その製造方法、そのような砥粒からなる研削配石。 およびそのような砥粒を研磨符として含む研磨布紙に関する。

[0002]

【従来の技術】立方晶盤化ほう素(以下、cBNと略称する)は六方晶盤化ほう素(以下、nBNと略称する)をcBNの熱力学安定条件である高温高圧で処理することにより製造される。cBN粒子はダイヤモンドに次ぐ40硬さを有し、しかも、化学的安定性、特に鉄系被削材に対する安定性がダイヤモンドより優れているため、砥石、研磨布紙などの研削砥粒として使用されている。【0003】cBN粒子の製法に関しては、特開昭59~57905号、特開昭59~73410号、特開昭59~73411号を含め、多くの提案がなされており、これらの一般的製法により得られるcBN粒子は上記のように優れた硬さと化学的安定性を保有している。しかしながら、これらのcBN粒子は通常の電君砥石あるいはメタルボンド砥石に使用するには問題ないが、切れ等50

が要求される研削配粒用途には適しているとは言えない。切れ味が要求される研削配粒に使用されるcBN粒子は低かさ比重すなわち形状がシャープであり、且つ、cBNの肉質としては緻密であることが望まれる。

2

【0004】本出類人は、形状がシャープで且つ内質が比較的緻密なでBN粒子を提供することを目的として検討を重ねた結果、ABNに、C額、Si額および水煮化アルカリ、水素化アルカリ土類またはその他のでBN合成触媒を加えた反応系を高温高圧処理する製法を見出し、さきに特許出類を行った(特関平2-35931)。特関平2-35931号に記載される方法により製造されるでBN粒子は、高いかさ比重と高いタフネスを有しており、微密で透明であり鋭いエッジを有しており、微密で透明であり鋭いエッジを有しており、微密で透明であり鋭いエッジを有しており、微密で透明であり鋭いエッジを有しており、微密で透明であり鋭いエッジを有しており、都密で透明であり鋭いエッジを有しており、微密で透明であり鋭いエッジを有しており、微密で透明であり鋭いエッジを有しており、研削砥石に用いたとき良好な切れ味を示すが、研削を維続していくと、エッジが丸くなり、切れ味が鈍化していくことがわかった。

【0005】また、形状がシャープなcBN粒子を得る 別法として、特開館51-37897号には、hBNと CBN合成用触媒とを粉末混合せずに、粉末の成形物ま たは予め焼結体を相互に接触させ、cBNの合成に適す る温度、圧力の条件下で処理することにより、細長いc BN粒子を製造する方法が記載されている。この方法に よれば、h BNスリーブと触媒コアを配置し、飼圧した 際にNBNスリーブに亀裂を生じ、匍匐し鮭娘が溶解し たときにその無穀部に溶解触媒が入り込み、結果とし て、細長いcBN粒子が得られると能定される。しかし ながら、加圧時にhBNスリーブに亀穀が生じても通常 c B N粒子を合成する際に必要な5GPaの圧力を掛け 30 れば、一たん生じた亀裂は、亀裂が生じなかった部分と 同じように圧縮され、溶融触媒が優先的に入り込むこと は難しいと考えられる。また、この方法ではhBN部と 触媒部を分けて配置するため変換量が少なく工業的に不 利である。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、上記のような従来の技術の問題点を改良して、肉質が緻密透明であり、形状がシャープ、すなわち、かさ比重が低く、従って、研削砥粒として用いたときの切れ味が良く、しかも、研削負荷が小さくかつ切れ刃が減って抵抗が大きくなったときに自生発刃を起こし、新しい切れ刃が出現し、良好な切れ味が持続すると言う特性を有し、研削砥粒として有用なcBN砥粒を提供することにある。

【①①①7】さらに、本発明の他の目的は、そのような 砥粒の工業的有利な製造方法、そのような砥粒からなる 研削砥石、および研磨材としてそのような砥粒を有する 研磨布紙を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、低かさ

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/web144/20041125000025706737.gif&N... 11/24/2004

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/web144/20041125000049646582.gif&N... 11/24/2004

比重で高タフネス値を有する立方晶蜜化ほう素の砥粒であって、J i S - B 4 1 3 i 0 の規定に基づく粒度の分布が# 3 2 5 / 4 0 0 \sim # 6 0 / 8 0 の範囲に属し、且つ、同規定に基づく粒度の各区分の最大粒度(最小数値)を χ とするとき、かさ比重ねよびタフネスがそれぞれ下記式(1)および(2):

a. ≦ かさ比重 ≦ a. (1)
b. ≦ タフネス ≦ b. (2)
(但し、a.=2.581×10⁻¹x'-2.894×10⁻¹x'-9.491×10⁻¹x+1.892
a.=4.316×10⁻¹x'-1.662×10⁻¹x'
-5.992×10⁻¹x+1.714
b.=3.245×10⁻¹x+9.264
b.=3.245×10⁻¹x+9.264
b.=3.245×10⁻¹x+9.264
b.=3.245×10⁻¹x-6.736)
を満足することを特徴とする立方晶室化ほう素砥粒が提供される。

[0009] さらに、本発明によれば、六方晶室化ほう 素に立方晶窒化ほう素合成用触媒を配合した原料混合物 を高温高圧下に保持することによって立方晶窒化ほう素 砥粒を合成する方法において、該原料混合物中にさらに 5~50容置%の立方晶窒化ほう素合成に不活性な成分 を配合した原料混合物を用いることを特徴とする上記立 方晶窒化ほう素砥粒を製造する方法が提供される。 【①①10】さらに、本発明によれば、上記のようなc BN砥粒からなる研削砥粒が提供される。さらに、本発明によれば、上記のようなcBN砥粒を研磨材として含む研磨布紙が提供される。

[0011]

【発明の実施の形態】本発明の c B N 軽粒は、その粒度 分布の関数として規定される比較的低い特定のかさ比重と比較的高い特定のタフネス値を有することを特徴としている。すなわち、本発明の c B N 砥粒は、 J I S - B 4 1 3 0 の規定に基づく粒度の分布が#3 2 5 / 4 0 0 ~#60 / 8 0 の範囲に関し、且つ。同規定に基づく粒度の各区分の最大粒度(最小数値)を z とするとき、かさ比重およびタフネスがそれぞれ前記(1)および(2)によって規定される範囲に入ることを特徴としている。

【0012】JIS-B4130には、cBN粒子の粒度の区分とそれぞれの粒度区分に属する粒子の粒度分布特性(特定のエレクトロフォームふるいを用いて粒度試験によって決まる)について下記表1のとおり規定されている(但し、粒度の区分については、本願発明に関連する粒度区分#325/400~#60/80の範囲についてのみ表1に掲記した。)

[0013]

【表1】

0

!	5											5
4段目のふるい	2 光以上通過し てはならないふ るい	w 7	127	101	06	7.5	\$ 5	£. €	49	11		,
11	通過して もよい最 大の <u>歯</u>	Ж	8	10	10	10	11	11	11	11	15	15
段目のふる	かった なな いい か	%	80	8?	8.7	81	8.5	8.5	\$8	0.5	8.0	8 8
8	一定 なければな るいとその	шĦ	181	121	121	101	06	\$4	\$9	18	67	41
1124	でなる。	ズ	8	10	1.0	1.9	11	11	11	11	1.5	1.5
2段目の7	一定番以上。 てはいけない とその歯	w #	271	161	165	881	116	9.7	8.5	75	85	57
1段目のふるい	99.9%歯歯しなげればないないなるない	. w #	364	27.1	227	197	165	139	116	8	8.5	7.5
5-B4130	統領を変えるのとなるととなる。		69/89	80/100	100/120	120/140	140/170	170/200	200/230	130/270	270/325	\$25/400

上記並度の各区分の最大粒度(最小数値)をえとする。 例えば、#60/80の粒度区分では2=60, #140/170の粒度区分では2=140, #325/40 0の粒度区分では2=325である。

【0014】本発明のcBN砥粒は、その各粒度区分の 粒度々に対応して、かさ比重およびタフネスがそれぞれ 下記式(1)および(2)を満足している。

- a, ≦ かさ比重 ≦ a, (1)
- $b_z \leq g \gamma \lambda \lambda \leq b$, (2)

例えば、c B N 砥粒の試料の粒度分布が粒度区分#14 0/170~#100/120の範囲に亘っているとき

- は、この範囲内の全ての粒度区分(合計3つの粒度区分)のそれぞれに属する粒子が上記式(1)および(2)を満足している。
 - 【りり15】本発明のcBN配粒のかさ比重は一般に使用されているcBN配粒より低く、また、タフネスも一般に使用されているcBN砥粒より概して低い。上記式(1) および(2) によって規定される本発明のcBN配粒のかさ比重およびタフネスの許容範囲を一般に使用されているcBN配粒のかさ比重およびタフネスとともに数値として示すと下記表2のとおりである。
- 59 [0016]

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/web144/20041125000124844456.gif&N... 11/24/2004

7

8

【表2】

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
粒 度区分	物性項目	本発明の cBN砥粒	特別平2-35931に記載 されているcBN砥粒
60/80	かさ比強	1.81~1.69	1.94~1.84
30700	タフネス値	41~29	54~44
BA (100	かさ比重	1.80~1.68	1.93~1.83
80/100	タフキス値	50~38	63~53
100/100	かさ比重	1.78~1.65	1.91~1.81
100/120	タフネス値	56~44	69~59
120/140	かさ比重	1.761.65	1.80~1.80
120/140	タフネス値	82~50	75~65
140/170	かさ比雷	1.74~1.63	1.88~!.78
140/170	タフネス値	66~54	79~69
170/000	かさ此面	1.71~1.50	1.87~1.77
170/109	タンネス値	69~57	82~72
200/230	かさ比量	1.69~1.58	1.85~1.75
2007230	タフキス値	78~61	85~75
230/270	かさ比重	1.67~1.56	1.84~1.74
230/210	タフネス値	75~63	88~78
270/325	かさ比重	1.85~1754	1.83~1.73
210/349	タフネス値	77~85	90~80
325/406	かさ比重	1.83~1.51	1.81~1.71
9697470	タフネス値	79~67	92~82

【0017】 ことで、「かさ比重」は、JIS-R61 26「入造研削材のかさ比重試験方法」のうち、試料採 取量を20.0±0.1g.シリンダー容績を8.0± 0. 10ml. 落下距離を95.0±1.0mmとした 測定方法により求められる。また、「タフネス」は、粒 度により指定された餘綱で範則した試量の一定量と鋼球 1個を、容績2m!のカブセルに入れて、一定時間(3 (). ()±(). 3秒) 粉砕した後、指定された篩網で篩削 し、範綱上の試料残存重量百分率で表したものである。 【0018】cBN砥粒のかさ比重が上記許容範囲を超 えて大きくなると、すなわち、粒子形状がブロッキーに なると砥粒の切れ味が悪くなる。上記かさ比重許容疑問 の下限は研削性能、特に高研削比を維持するのに必要な 要件であって、かさ比重が許容限界より低いと偏平状な いし針状のような異形状粒の割合が多くなって、研削性 能、特に研削比が低下する。

【①①19】タフネスは磁粒の形状に依存するところが多いものの、各粒度におけるタフネスの上限は、切れ時を持続させるために砥粒切刃の自生発刃を起こすのに必要な強さであって、タフネスが許容限界を超えて大きくなると自生発刃作用が起こり難くなって、切れ味が低する。一方、各粒度区分におけるタフネスの下限は自生発刃を適性に維持させるために必要な最低の強度であって、このタフネス許容下限より低くなると、砥粒の破損が早くなって研削性能、特に研削比が低下する。

【0020】本発明において目的とされる切れ味が良く 且つ長寿命の砥粒は、その粒度分布が上記所定の範圍に あって、且つ、各粒度区分における粒子のかさ比重とタ フネスがそれぞれ上記式(1) および(2) を満足する 場合にはじめて得られる。

【0021】本願発明のcBN配粒は、意法に従って、 50 hBNを高温高圧条件下におく方法において、hBNに

10

c B N 合成用触媒を配合した出発混合物中に、さらに、例えばアルミナのようなc B N 合成に不活性な成分を添加することによって得ることができる。すなわち、c B N 合成の試料空間に、h B N および c B N 合成用触媒の他に、c B N 合成に不活性なアルミナのような成分を添加しておくと、高温高圧下に生成した c B N 粒子が成長する過程で、粒子が不活性成分に接触するとそれ以上その方向には成長せず、その結果、形状がシャープな c B N 粒子が得られる。

【0022】 5 BNとしては通常市販されている純度が 98%以上のものを使用することができる。cBN合成 **用触媒としては(1)Liなどのアルカリ金属。これら** の窒化物(Li,Nなど)、複窒化物(Li,BN,な ど) (2) Ca. Sr. Mg、Baなどのアルカリ土領 金属、これらの室化物(CagNz、SrgNz、Mg 』N、Ba』N、など)、複窒化物(Ca』B、N。、Sr, B₂N₄、M₆,B₂N₄、B₈,B₂N₄など) (3) アルカ リとアルカリ土類金属の複合窒化物(LICABN) LiBaBN。など)を使用することができる。これら のc BN合成用触媒のなかでは、触媒の安定性がよく、 且つ緻密で透明な成長層が容易に得られる点で(3)ア ルカリとアルカリ土類金属の複合窒化物が好ましい。 【0023】cBN合成用触媒の使用量はhBN100 重量部に対して5~50重量部が好ましい。cBN合成 に不活性な成分としては、cBN台成域の高温高圧下に 相転位や分解をすることがなく、且つcBN合成用触媒 と反応しない物質が用いられ、その具体例としては酸化 アルミニウム、酸化ジルコニウム、ムライト、炭化ケイ 素はどが挙げられる。価格、入手し易さなどを考慮する と酸化アルミニウムが好ましい。不活性成分の形態は特 36 に限定されることはないが、基本的には粒状物が用いら れ、その許容位度範囲は一般に5~5、000µm程度 である。

【0024】cBN合成に不活性な成分の使用量は、試料空間の5~50容質%である。使用量が5容量%未満であると形状シャープ化の効果が小さい。また、50容置%を越えるとcBNの変換置が減るため工業的に不利となる。hBNにcBN合成用触媒と上記不活性成分を配合した原料混合物を高温高圧処理する際の条件は、従来と同様でよく、一般に、圧力4~6GPa、温度1、400~1、600℃、時間5分~10時間の範囲で適置速択される。最も好ましい条件は圧力約5GPa、温度約1、450℃、時間約15分である。

【①①25】本発明のcBN砥粒は前途のように研削砥粒として有用である。より具体的には砥石(ビトリファイド 電音およびメタルボンド)および研磨布紙などが挙げられる。また、cBN粒子の表面に主にニッケル、コバルトなどの金属を被覆せしめてレジノイド砥石として用いることもできる。

cBN粒子

* [0026]

【実能例】

【0027】以下、実施側について本発明をより具体的 に説明する。

実施例1 (確証の調製)

トBN(昭和電工(株)製UHP-1、平均校径8~1 ①μπ、純度98%)100重量部に cBN合成触媒と してし CaBN、10重量部および酸化アルミニウム (昭和電工(株)製WA#180)を試料空間の20容 置%になるよう添加し、試料を成形した。試料を5GP a. 1500℃で高圧高温処理することにより黄色透明 な cBN粒子を得ることができた。得られた cBN粒子 を処理し、JIS-B4130粒度区分80/100お よび230/270に粒度を調整した。各粒度区分の粒 子のかさ比重及びタフネスは下記のとおりであった。

 粒度区分
 かさ比重
 タフネス

 80/100
 1.74
 42

 230/270
 1.62
 73

 [0028] 比較例1 (砥粒の調製)

5 酸化アルミニウムを添加しなかった他は実施例1と同じ方法ででBN粒子を得た。得られたでBN粒子の粒度区分およびそれぞれの粒度区分の粒子のかさ比重およびタフネスは下記のとおりであった。

 拉度区分
 かさ比量
 タフネス

 80/100
 1.88
 45

 230/270
 1.78
 78

 【0029】比較例2(低粒の調製)

圧力6.5GPa、温度1650℃で高圧、高温処理した他は比較例1と同じ方法でcBN粒子を得た。得られたcBN粒子の粒度区分およびそれぞれの粒度区分の粒子のかさ比重およびタフネスは下記のとおりであった。

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/web144/20041125000139842294.gif&N.. 11/24/2004

 粒度区分
 かさ比重
 タフネス

 80/100
 1.90
 34

 230/270
 1.72
 60

【0030】比較例3 (砥粒の調製)

実施例1で得られたcBN粒子を形状分離機にかけて、さらにシャープな形状を有する粒子を集中的に採取した。得られたcBN粒子の粒度区分およびそれぞれの粒度区分の粒子のかさ比重およびタフネスは下記のとおりであった。

 粒度区分
 かさ比重
 タフネス

 80/100
 1.63
 31

 230/270
 1.51
 58

 【0031】実施例2(低石セグメントの作成)

実施例1で得られたcBN砥粒(粒度80/100、かさ比重1.74、タフネス42)を用い、下記配合処方によって複合物を調製し、150℃で加圧成形後、950℃で零焼成して砥石セグメントを作成した。焼成後の低石セグメントの気孔率は30容置%であった。

50容置%

ホウ硅酸系ピトリファイドボンド

フェノール樹脂

20容置%

10容置%

【0032】実能例3(砥石セグメントの作成) 実施例1で得られたcBN砥粒(粒度230/270、 かさ比重1.62、タフネス73)を用い、下記配台処*

cBN粒子

*方によって混合物を調製し、150°Cで加圧成形後、9 50°Cで本焼成して砥石セグメントを作成した。 焼成後 の砥石セグメントの気孔率は30容量%であった。

5 () 容置%

20容置%

10容置%

ホウ硅酸系ピトリファイドボンド フェノール樹脂

【0033】比較例4(砥石セグメントの作成) さ比重1.88.タフネス45〉を用い、下記配合処方※

※によって混合物を調製し、150℃で加圧成形後、95 比較例1で得られたcBN砥粒(粒度80/100、か 10 0℃で本焼成して配石セグメントを作成した。 流成後の 砥石セグメントの気孔率は30容量%であった。

50容置%

20容置%

1 () 容置%

cBN粒子

ホウ硅酸系ピトリファイドボンド

フェノール樹脂

【0034】比較例5(砥石セグメントの作成) 比較例2で得られた粒度80/100 かさ比重1.9 Oおよびタフネス34を有するcBN砥粒を用い、下記 配合処方によって混合物を調製し、150°Cで加圧成形★

cBN粒子

ホウ硅酸系ピトリファイドボンド

フェノール樹脂

★後、950℃で本焼成して研削砥石セグメントを作成し た。焼成後の砥石セグメントの気孔率は30容量%であ った。

50容置%

20容置%

10容置%

【①①35】比較例6(砥石セグメントの作成) 比較例3で得られた粒度80/100,かさ比重1.6 3およびタフネス31を有するcBN砥粒を用い、下記 配合処方によって混合物を調製し、150℃で加圧成形合

cBN粒子

ホウ硅酸系ピトリファイドボンド

フェノール樹脂

☆後、950℃で本焼成して研削砥石セグメントを作成し た。総成後の砥石セグメントの気孔率は30容量%であ った。

50容置%

2) 容置%

10容置%

【0036】比較例7(砥石セグメントの作成) 比較例1で得られたcBN砥粒(粒度230/270、 かさ比重1.78、タフネス78)を用い、下記配台処◆

cBN粒子

ホウ硅酸系ピトリファイドボンド

フェノール樹脂

◆方によって混合物を調製し、150°Cで加圧成形後、9 30 50℃で本焼成して研削砥石セグメントを作成した。焼 成後の砥石セグメントの気孔率は30容量%であった。

50容置%

20容置%

10容置%

【0037】比較例8(砥石セグメントの作成) 比較例2で得られた粒度230/270、かさ比重1. 72. タフネス60を有するcBN砥粒を用い、下記配 合処方によって混合物を調製し、150℃で加圧成形 *

cBN粒子

ホウ硅酸系ピトリファイドボンド

フェノール樹脂

*後、950℃で本焼成して砥石セグメントを作成した。 焼成後の砥石セグメントの気孔率は30容量%であっ tc.

50容置%

20容置%

10容置%

【①①38】比較例9(砥石セグメントの作成) - 比較例3で得られた粒度230/270、かさ比重1. 51. タフネス58を有するcBN砥粒を用い、下記配 台処方によって混合物を調製し、150℃で加圧成形 ※

cBN粒子

ホウ硅酸系ピトリファイドボンド

フェノール樹脂

※後、950℃で本焼成して砥石セグメントを作成した。 焼成後の砥石セグメントの気孔率は3 ()容置%であっ tc.

5 () 容置%

20 容置%

10容置%

た砥石セグメントを、倉法に従ってアルミ台金に接着し 上記実施例2および3、ならびに比較例4~9で作成し 50 で砥石化した後に、以下の条件で研削試験を行った。

【①①39】研削砥石の作成および研削試験

http://www4.ipdl.ncipi.go.jp/tjcontenttrns.ipdl?N0000=21&N0400=image/gif&N0401=/NSAPITMP/web144/20041125000158414378.gif&N... 11/24/2004

砥石:、14A1形、150°×125'×15'×5°×3*×76.2"

研削盤: 微軸平面研削盤(砥石輪モーター 3.7KW)

綾削村: SKI!-51. (HRC 62~64)、綾研削面200mm長×

100mm幅

研削方式: 温式平面トラバース研削方式

研削条件: 砥石国速度 1800m/min テーブル速度 15m/min

クロス送り 2mm/pass、切込み20.30um

研削液: JIS W2種 cBN専用液、50倍液、9 !/min

研削結果を表3~表6に示す。

*【表3】

[0040]

*19 <u>数度80/100、切込み20μmのとき</u>

種類	実施例2	近較例4	比較例5	比較例6	
研削比	937	935	873	620	
研削動力(質)	1330	1810	2000	1980	
面 平行方向路(火江	a) 0.27	0.28	0.25	0.25	
面 平行方向函(μι 直角方向路(μι	n) 9.89	0.93	0.87	0.87	

[0041]

※ ※【表4】 対度80/100、切込み30μmのとき

種	類	実施例2	比較例4	比較例5	比較例6	
研	削比	658	674	628	550	
部	似動力(¥)	1690	2170	2250	2280	
匴	平行方向Ba(μm)	0.28	0.28	0.27	. 0.27	
の間の	直角方向Ba(μm)	1,32	1.25	1.30	1.35	

***0042**]

★ ★【表5】 <u> 乾疫230/270、切込み20μmのとき</u>

穫	類	実施例3	比較例?	比較例8	比較例9
新削	比	2411	2358	2085	1990
矿削動	力(的)	580	710	710 810	
0 本	行方向Ba(#a)	0.18	0.19	0.18	0.18
東 東 東	角方向险(火心)	0.75	0.76	0.68	0.75

[0043]

☆ ☆【表6】 粒度230/270、切込み30μmのとき

毽	類	実施例3	比較例?	比較例8	此数例9
谺	削比	929	945	303	827
研育	间勒力(f)	670	940	1010	1930
面	平行方向险(μm)	0.21	0.22	0.20	0.21
面框	直角方向Re(gra)	1.70	1.6?	1.61	1.55

[0044]

【発明の効果】本発明のcBN砥粒は、肉質が緻密透明であり、形状がシャープ。すなわち、かさ比重が低く、従って、研削砥粒として用いたときの切れ場が良く、しかも、研削負荷が小さくかつ切れ刃が減って抵抗が大き

くなったときに自生発刃を起こし、新しい切れ刃が出現 し、良好な切れ味が持続すると言う特性を有する。従っ て、このでBN砥粒は、研削配粒に好適であって、砥石 および研磨布紙などとして有用である。 (72)発明者 牧 昌和 長野県塩尻市大字宗賀1 昭和電工株式会 社塩尻工場内